

出國報告（出國類別：實習）

105 年臺韓專利審查官 交流與研習計畫

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：董柏昌 專利助理審查官

李惟德 專利助理審查官

派赴國家：韓國

出國期間：105 年 10 月 30 日至 105 年 11 月 5 日

報告日期：105 年 12 月 20 日

摘要

本次臺韓專利審查官交流期間為 105 年 10 月 30 日至 105 年 11 月 5 日，由本局派遣二位審查官赴韓國智慧財產局進行一週的交流活動。對雙方專利法規、審查基準、審查實務、檢索資料庫與檢索策略等瞭解與討論，經驗交流和心得分享。交流期間參訪專利資訊策進中心、專利法院、韓國智慧財產局首爾辦公室等。透過臺韓智慧財產局交流建立雙方友好的關係及實際的合作經驗。

關鍵詞：臺韓專利審查官交流、臺韓審查官交流、審查實務、檢索策略、審查品質、審查基準。

目錄

壹、目的.....	4
貳、過程.....	5
參、韓國智慧財產局及交流部門簡介.....	7
一、韓國智慧財產局簡介.....	7
(一)專利審查近況.....	8
(二)專利審查人力增加.....	8
(三)發明專利申請量穩定成長.....	9
(四)首次通知期間縮短.....	10
(五)韓國近期重要專利相關修法.....	11
二、韓國智慧財產局專利審查第一部之電力科技審查科簡介.....	13
三、韓國智慧財產局專利審查第二部之半導體審查科簡介.....	13
肆、案件審查交流.....	14
一、導電材料技術領域案件交流.....	14
(一)前置作業與交流案件挑選.....	14
(二)案件交流結果.....	15
(三)案件交流心得.....	17
二、半導體技術領域案件交流.....	18
(一)前置作業與交流案件挑選.....	18
(二)案件交流結果.....	18

(三)案件交流心得.....	21
伍、交流議題.....	26
一、韓國智慧財產局審查系統簡介.....	26
二、臺韓新型專利制度比較.....	31
三、韓美專利合作檢索計畫.....	32
四、韓國專利師考科.....	35
五、專利資訊策進中心簡介.....	37
六、韓國專利法院.....	38
(一)韓國專利訴訟制度簡史.....	38
(二)專利法院組織.....	38
(三)韓國智慧財產案件訴訟制度及其演進.....	40
(四)統計數據.....	42
(五)新的專利侵權案件進行原則.....	44
陸、心得及建議.....	45
一、心得.....	45
二、建議.....	47

壹、目的

韓國智慧財產局是世界五大智慧財產局(IP5)之一，近年來專利申請量是全球第四，其重要性不言而喻。故本局派遣二位專利審查人員赴韓國智慧財產局進行交流及比較研究，從專利法規、專利制度、專利審查基準及專利審查實務進行雙向瞭解及討論。專利權是屬地主義且各國專利環境不盡相同，透過本次交流，亦蒐集韓國智慧財產局、專利法院、專利檢索協力機構各個面向的資訊。藉由臺韓雙邊專利審查人員友善交流，進一步奠定未來臺韓雙邊實際合作良好的基礎。

貳、過程

本次交流行程簡述如下：

2016年10月31日

09:30~10:30 會見交流對口

10:30~12:00 會見專利制度管理科科长及副科长

12:00~13:30 午餐

13:30~14:00 會見專利審查第一部部長

14:00~15:00 會見電力科技審查科科长及審查科環境介紹

15:00~16:00 會見半導體審查科科长及審查科環境介紹

16:00~17:00 交流案件準備

2016年11月1日

09:30~11:00 案件討論

11:00~12:00 系統試用

12:00~13:30 午餐

13:30~15:30 案件討論

15:30~17:00 韓國智慧財產局近況簡介

2016年11月2日

09:30~11:00 赴首爾

11:00~13:00 參訪韓國智慧財產局首爾辦公室

13:30~14:30 午餐

14:30~16:00 參訪青瓦台

16:00~17:30 返回大田

2016年11月3日

09:30~11:00 案件討論

11:00~12:00 專利制度討論

12:00~13:30 午餐

13:30~15:00 參訪專利資訊策進中心(PIPC)

15:00~17:00 案件及專利制度討論

2016年11月4日

09:30~11:00 案件討論

11:00~12:00 系統試用

12:00~13:30 午餐

13:30~16:00 參訪專利法院

參、韓國智慧財產局及交流部門簡介

一、韓國智慧財產局簡介

韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Office, KIPO)為韓國專利、商標、設計等智慧財產之主管機關，主要業務包含智慧財產審查、舉發及上訴、培訓、促進、保護等業務。創立於 1949 年，1998 年由首爾遷移至目前大田廣域市(Daejeon)政府綜合體(government complex)現址，總人數約一千六百人。韓國智慧財產局(KIPO)與歐洲專利局(EPO)、日本特許廳(JPO)、美國專利商標局(USPTO)、及中國知識產權局(SIPO)併稱智慧財產五大局(IP5)，近幾年專利申請量為全球第四大，KIPO 亦為專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)下的重要國際檢索機構之一。

(一)專利審查近況

近年來韓國智慧財產局專利審查人力持續增加，發明專利申請量穩定增加，首次通知期間減少。

(二)專利審查人力增加

韓國智慧財產局總共約八百四十三位專利審查人員，共三個專利審查部，其中包含三十三個專利審查科，平均每科二十六位審查人員。每個專利審查科設科長一位、副科長一位、及小組長三至四位，科長常兼任其中一小組長。



審查人員包含審查官及約聘審查官，審查官包含一般考試及專業考試二種，皆具有公務員身分，約聘審查官多具有博士學歷。

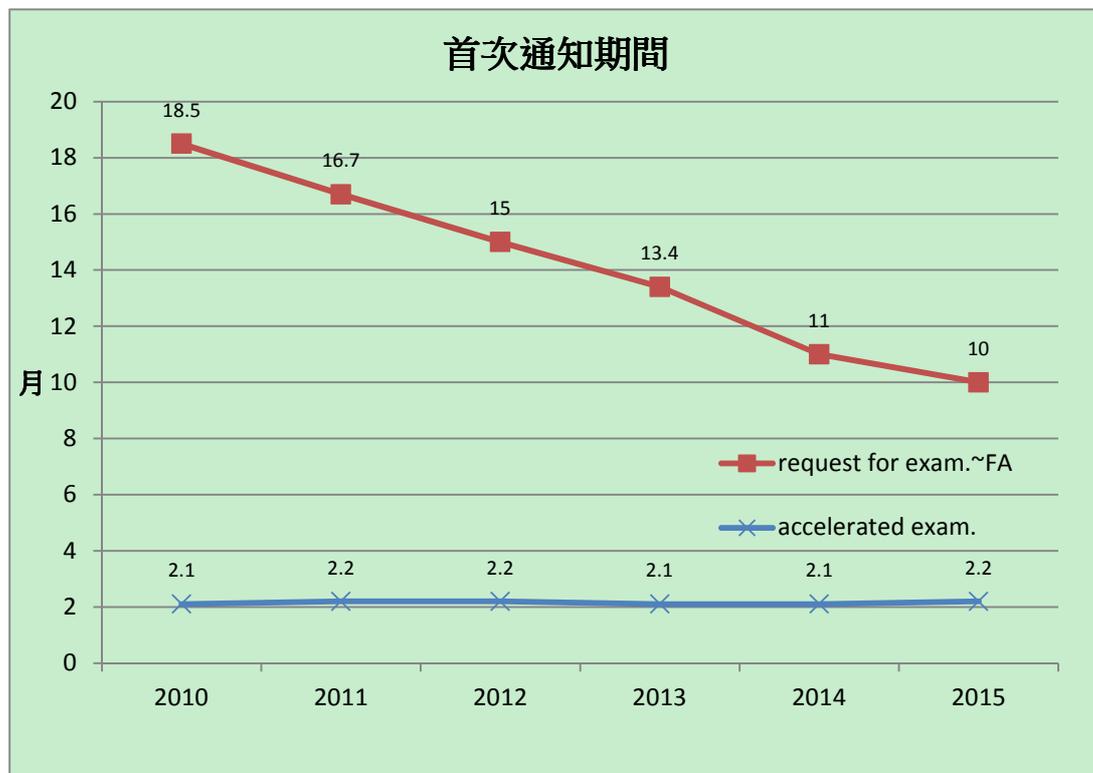
(三)發明專利申請量穩定成長

在韓國的專利申請量自 2009 年至今呈現穩定成長的趨勢，在 2015 年發明專利申請量達到二十一萬件。發明專利申請人之中，韓國本國申請人占 78.3%，外國申請人占 21.7%，足見韓國申請人對申請專利的普遍及重視。實用新型專利在韓國為實體審查，專利期限為十年，因此申請量較發明專利少且逐年呈現減少的趨勢。實用新型專利申請人之中，韓國本國申請人占 95.2%，外國申請人占 4.8%。



(四)首次通知期間縮短

首次通知期間為申請人申請實體審查日至智慧財產局發出第一次審查意見通知的期間，首次通知期間為是否能快速取得專利權的重要指標。近年韓國智慧財產局的首次通知期間持續縮短，2015 年為 10 個月，與日本特許廳皆為一年以內，達到快速的審查。審查人力的增加以及各國智慧財產局之間的審查合作，皆有助於縮短首次通知期間。



(五)韓國近期重要專利相關修法

1、申請實體審查期限由五年縮短為三年(\$59)

自申請日起算三年內，任何人可提出實體審查的請求。由原本五年的期限縮短為三年，目的在於及早核准專利權。此修法將於 2017 年 3 月 1 日生效。

2、依職權訂正之範圍擴大到包含不明確造成之無效(\$66-2)

依職權訂正目的在於申請案於可核准狀態下存在微小錯誤，為了減少公文往返時間，專利審查人員得依職權訂正以迅速核准專利。本條此次修正將依職權訂正之範圍擴大到不明確造成之無效。申請人若提交不接受依職權修改之申復理由，則核准通知視為無效。此修法將於 2017 年 3 月 1 日生效。

3、專利可被公眾參與(\$132-2)及審查人員依職權再次審查撤銷(\$66-3)

公眾參與意思是任何一方在專利核准後六個月內，皆可提起撤銷專利權之請求，但僅基於不具新穎性及不具進步性等專利要件。在韓國智慧財產局的撤銷請求，與日本特許廳的核准專利之異議(opposition)系統近乎相近，皆為單造複審制。但仍有差異，日本特許廳可接受的理由除了專利要件外，尚包含記載要件。本條撤銷制度的修改旨在提升專利權品質及安定性。此修法將於 2017 年 3 月 1 日生效。

審查人員依職權再次審查(re-examination)，意思是審查人員發現嚴重錯誤，在專利權生效前及專利核准之後，審查人員可依職權撤銷核准審定進行再次審查，本制度在於提高專利權的品質及安定性。此修法將於 2017 年 3 月 1 日生效。

4、審查人員可指示申請人提供其他國家(適用巴黎和約優先權)審查時引用之技術文件(\$63-3)

要求申請人提出申請案在其他國家的審查相關資料制度，與美國專利商標局

(USPTO)資訊揭露聲明(information disclosure statement)制度類似，藉由參考其他國家的審查結果，可提高專利權的安定性及增加審查效率。

5、提交證據是義務，不論是否為機密資訊或營業秘密，不僅為了專利侵權的證明，也為了損害賠償的舉證責任，其效力將被檢視。進一步，根據新創立的條款，當拒絕提供相關證據為無合理的理由時，對造的主張將被視為有效。
於 2016 年 6 月 30 日生效

6、當韓國智慧財產局的核駁審定被智慧財產審判及上訴委員會(Intellectual Property Tribunal, IP Trial and Appeal Board, IPTAB)撤銷，其上訴請求費用應全數退還。於 2016 年 6 月 30 日生效。

二、韓國智慧財產局專利審查第一部之電力科技審查科簡介

本次交流對象是吳芝英(Ji-Young OH)女士，具有物理博士學歷，隸屬於專利審查第一部(Patent Examination Bureau 1)下之電力科技審查科(Electric Power Technology Examination Division)，該科共有成員 27 人。吳芝英女士的審查技術領域為導電材料、絕緣材料、及超導體，專利審查年資二年。

三、韓國智慧財產局專利審查第二部之半導體審查科簡介

本次半導體技術領域係與韓國智慧財產局專利審查第二部(Patent Examination Bureau 2)的半導體審查科(Semiconductor Examination Division)進行交流，該科共有成員 26 人，韓方交流對應窗口為去年來本局參加臺韓專利審查官交流的李靜恩(Jung-Eun LEE)審查官。李靜恩審查官為弘益大學學士及延世大學碩士畢業，主修電子工程，曾任執業專利師，2011 年進入韓國智慧財產局服務，擔任專利審查官一職至今，目前所承審的 IPC 分類號範圍為 H01L 21 與 H01L 23，主要負責電漿製程、濺鍍，以及晶圓切割之發明專利案件審查。

肆、案件審查交流

一、導電材料技術領域案件交流

(一)前置作業與交流案件挑選

本次交流雙方共同審查了四件專利申請案，為導電材料技術領域，國際專利分類號(International Patent Classification，IPC)為 H01B，在臺韓二國皆提出實體審查之專利申請案。案件討論對象是吳芝英女士。交流案件討論以雙方完成審查意見通知函的過程與結果進行比較，以瞭解雙方於審查實務上的差異。

交流討論案件依循以下步驟進行：

- a.確認案件基本資料、有無修正。
- b.比較雙方請求項。
- c.解讀請求項、參酌說明書及圖式。
- d.分享檢索策略、檢索工具。
- e.討論可專利性、記載要件、單一性。
- f.討論基準差異。
- g.檢查案件有無其他錯誤。

(二)案件交流結果

案件	申請人		審查意見	引證	其他討論議題
案件 1 透明導電膜	JP	TIPO	明確性 擬制喪失新穎性 進步性	TW; TW	資料庫內涵
		KIPO	進步性	JP+WO	
案件 2 透明導電體	JP	TIPO	多附多 進步性	CN; TW+TW	不明確情況下之 進步性論述
		KIPO	多附多 明確性	-	
案件 3 導電膜	KR	TIPO	明確性 支持要件 進步性	TW; CN	對申請案評分
		KIPO	進步性	KR	
案件 4 金屬積層體	JP	TIPO	擬制喪失新穎性	TW; TW	英語訓練
		KIPO	支持要件 明確性 進步性	JP+KR	

在這四件案件之中，雙方對於請求項解讀、單一性判斷、依附關係等審查實務皆相同。在新穎性及進步性判斷則因為檢索結果使用引證不同而有差異。記

載要件判斷在不明確用語的判斷存在差異，其餘為技術性判斷之差異。

在交流案件中二件申請案之中皆出現「主要成分」、「主成分」用詞，例如 TiO₂ 作為主要成分、金屬為主成分之記載方式。韓方認為此種界定不明確，在審查意見通知中作為不予專利事由。我方則認為主要成分的描述方式，具有相對多數或絕對含量超過 50% 二種解釋方式，其範圍較使用開放式連接詞的撰寫方式限縮，因此認為不至於造成不明確。可見在不明確用語的審查實務上韓方審查較我方嚴格。

在我方專利審查基準中表現方式所致之不明確章節(審查基準第二篇第一章 2.4.1.5(5))中列舉之不明確用語包含「主要是」，惟若該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。

在韓方專利審查基準中不明確及不簡潔示例章節(審查基準 Part II, Ch.4, 4. (3) ⑤ Ex.2)中列舉的不明確用語亦包含「主要是」，即便使用此不明確表示方式，其意義明確被發明說明所支持且明確界定，發明不應被認定不明確。

TIPO 審查基準第二篇第一章 2.4.1.5(5)	KIPO 審查基準 Part II, Ch.4, 4. (3) ⑤ Ex.2 (2013 年 7 月英文版)
2.4.1.5 表現方式所致之不明確 (5)請求項中使用「視需要時」、「必要時」、「若有的話」、「尤其是」、「特別是」、「主要是」、「最好是」、「較佳是」、「例如」、「等」、「或類似的」或類似用語。 惟若該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍，則得以此類用語表現。	(3)發明不明確不簡潔之情況如下： ⑤當請求項包含不明確表示方式，然而，即便使用此不明確表示方式，其意義明確被發明說明所支持且明確界定，發明不應被認定不明確。 例 2:「主要是」、「主要步驟」、「適當」、「適量」、「多」、「高」、「大部分」、「幾乎」、「近似」、「約」、。

臺韓雙方在不明確用語的審查基準內容相近，皆有列舉「主要是」屬於易造成不明確用語，惟若經審查人員判斷整體技術意義及範圍明確，仍可屬於明確。韓方在「主要成分」、「主成分」的審查實務判斷上較我方嚴格。

(三)案件交流心得

韓方使用的檢索系統可使用韓文關鍵字檢索韓國專利文獻及日本專利文獻全文，是日韓雙方專利文獻機器翻譯交換的成果，故韓方近來使用較多的日文專利文獻作為引證。我方檢索系統可使用繁體中文關鍵字檢索本國專利文獻及中國大陸專利文獻全文。日本專利文獻及中國大陸專利文獻數量龐大，為具有檢索價值的資料庫對象。雙方資料庫皆可使用英文關鍵字檢索英文專利文獻的全文，國際專利分類號 IPC 等進行檢索。全文檢索皆具有布林邏輯、鄰近運算子、切截字元等功能，皆為專業的檢索系統。

二、半導體技術領域案件交流

(一)前置作業與交流案件挑選

本次半導體技術的交流領域為國際專利分類號(IPC)之H01L21:「適用於製造或處理半導體或固體裝置或部件之方法或設備」及H01L23:「半導體或其他固體裝置之零部件」，選擇案件的規則如下：(1)IPC分類的主分類號落在H01L 21與H01L 23及其次分類號內；(2)須於兩國皆有申請實體審查。經過多次討論，決定討論 4 件案件。雙方確認交流案件後，我方即對各交流案件之審查意見、檢索歷程及檢索報告資料進行英文翻譯作業，並於正式交流前一週預先以電子郵件寄予韓方供其先予參閱，以利比較雙方檢索歷程、引證案及審查意見之差異處，俾利正式交流時進行後續討論。此外，由於韓方之審查意見等英譯資料可於韓國智慧財產局官網取得，我方於交流前亦自行前往至該網站下載韓方資料並先行研讀。

(二)案件交流結果

本次共討論 4 件案件，每次討論均依照下列步驟進行：理解該申請案之技術特徵、比對雙方的申請專利範圍、就所檢索到的引證逐項比對新穎性與進步性、討論記載要件是否符合規定、討論檢索策略、相關審查基準討論。討論對象皆為交流對口李靜恩審查官，各案件討論結果彙整於下表：

	TW申請號	申請人國籍 /KR申復期間	審查意見		引證
1	1041XXXX9	申請人國籍：韓國 申復期間:2個月	TIPO	新穎性 進步性	US(2)
			KIPO	記載要件 進步性	KR(2)
2	1021XXXX7	申請人國籍：日本 KR申復期間:2個月	TIPO	進步性	JP(3)
			KIPO	進步性	JP(3)
3	1031XXXX0	申請人國籍：日本 KR申復期間:2個月	TIPO	記載要件 進步性	AAPA TW(3)
			KIPO	記載要件 進步性	JP(2)
4	1051XXXX8	申請人國籍：韓國 申復期間:2個月	TIPO	新穎性 進步性	WO(1)
			KIPO	記載要件 新穎性 進步性	1 st :JP(1),KR(1) 2 nd :JP(2),KR(1)

1、TW申請號1041XXXX9案件討論

關於本案請求項1，韓方敘明韓方引證1已揭示一種利用雷射光處理物件的雷射處理方法，其中所述物件形成有半導體晶圓以及在所述半導體晶圓的一表面上的層，所述雷射處理方法包括：傳遞沿著同軸路徑行進的多個雷射光通過所述半導體晶圓，且分別在配置在鄰近所述半導體晶圓的所述表面的位置形成聚焦點，其中所述層的所述表面形成所述半導體晶圓的邊界。韓方引證2另已揭示在所述半導體晶圓的一表面上的金屬層。雖韓方引證1~2未揭示在所述金屬層的表面位置形成聚焦點；惟其僅為該領域之習知技術，並無不可預期之功效。故請求項1為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術韓方引證1~2所能輕易完成者，故不具進步性。

關於本案請求項1，我方敘明引證1已揭示一種利用雷射光處理物件的雷射處理方法，其中所述物件形成有半導體晶圓以及在所述半導體晶圓的一表面上的金屬層，所述雷射處理方法包括：傳遞沿著同軸路徑行進的多個雷射光通過所述半導體晶圓，且分別在所述金屬層的表面及配置在鄰近所述半導體晶圓的所述表面的位置形成聚焦點，其中所述金屬層的所述表面形成所述半導體晶圓的邊界。我方引證1已揭示本項之所有技術特徵，故不具新穎性。

韓方審查官表示，關於本案請求項1，雖韓方引證1~2未揭示在所述金屬層的表面位置形成聚焦點之技術特徵，且該申請案之申請人於韓國智慧財產局之審查及再次審查階段的申復中亦強調這一點；惟韓方審查官認為所述之技術特徵僅為該領域之習知技術，並無不可預期之功效。由於韓國再次審查係由同一審查官進行審查，故於再次審查中亦由同一審查官審查後給予核駁處分。

2、TW申請號1051XXXX8案件討論

關於本案，韓方敘明引證1已揭示一種接合線，包括：線芯，含有銀（Ag）作為主要組分並含有選自鉑（Pt）、鈀（Pd）、銻（Rh）、鐵（Os）、金（Au）及鎳（Ni）中的至少一種元素；以及金（Au）材料的塗層，形成於所述線芯的外表面上；一種打線接合方法，所述打線接合方法包括：製備接合線；在大氣中在所述接合線的末端處形成無空氣焊球；以及將所述無空氣焊球附著至半導體晶片的焊墊，其中所述接合線包括：線芯，含有銀（Ag）作為主要組分並含有選自鉑（Pt）、鈀（Pd）、銻（Rh）、鐵（Os）、金（Au）及鎳（Ni）中的至少一種元素；以及金（Au）材料的塗層，形成於所述線芯的外表面上。韓方引證1已揭示請求項1、6之所有技術特徵，故不具新穎性。韓方引證2另已揭示所述塗層的厚度為約30奈米至200奈米，所述塗層的厚度為約40奈米至170奈米，其中所述金（Au）的純度等於或大於99%，所述塗層是藉由鍍覆而形成。故請求項2~4、7~8、10為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術韓方引證1~2所能輕易完成者，故不具進步性。請求項5、9並未發現不予專利理由。

關於本案，我方敘明引證1已揭示一種接合線，包括：線芯，含有銀（Ag）作為主要組分並含有選自鉑（Pt）、鈀（Pd）、銻（Rh）、鐵（Os）、金（Au）及鎳（Ni）中的至少一種元素；以及金（Au）材料的塗層，形成於所述線芯的外表面上，所述塗層的厚度為約30奈米至200奈米，所述塗層的厚度為約40奈米至170奈米，其中所述金（Au）的純度等於或大於99%，其中當在大氣中在所述接合線的末端處形成無空氣焊球時，所述無空氣焊球的外表面上的金（Au）含量為約5wt%至35wt%；一種打線接合方法，所述打線接合方法包括：製備接合線；在大氣中在所述接合線的末端處形成無空氣焊球；以及將所述無空氣焊球附著至半導體晶片的焊墊，其中所述接合線包括：線芯，含有銀（Ag）作為主要組分並含有選自鉑（Pt）、鈀（Pd）、銻（Rh）、鐵（Os）、金（Au）及鎳（Ni）中的至少一種元素；以及金（Au）材料的塗層，形成於所述線芯的外表面上，所述塗層的厚度為約30奈米至200奈米，所述塗層的厚度為約40奈米至170奈米，所述無空氣焊球的外表面上的金（Au）含量為約5wt%至35wt%。我方引證1已揭示請求項1~9之所有技術特徵，故不具新穎性。雖我方引證1未揭示所述塗層是藉由鍍覆而形成；惟其僅為該領域之習知技術，並無不可預期之功效，故不具進步性。

韓方審查官表示，雖本案並非其承審之案件，但我方引證可證明請求項 5、9 不具新穎性，韓方引證無法證明請求項 5、9 不具專利要件，故會建議承審之審查官參考我方引證。

(三)案件交流心得

由前述之交流案件比較表可知，在韓國，審查意見通知函的申復期間，不論申請人的國籍，皆為2個月；此與我方依申請人是否為本國籍而有不同的申復期間，有所差異。

臺韓雙方在審查意見之論述上，韓國審查官於審查意見通知函中論述不具新穎性之理由時，亦會在審查意見通知中註明不具進步性；此種不具新穎性理由時同時引用不具新穎性與進步性法條之作法，與我方「申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包含擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無

須再審究其進步性」有所不同。

於判斷進步性時，引證間的結合動機一直是熱門議題。由於韓國智慧財產局官網上的韓國專利審查基準英文版係 2013 年 7 月版，為與現行的韓國專利審查基準作比較，特請李靜恩審查官就韓國專利審查基準英文版 2013 年 7 月版中關於進步性引證間的結合動機與現行的韓國專利審查基準進行比對，確認有無修改之處；經比對後，其表示兩者係一致。將之與本局專利審查基準表列如下，可作為局內修正進步性審查基準的參考。

1、考慮引證間結合動機的情況

KIPO專利審查基準 (2013.7)	TIPO專利審查基準 2014年版	TIPO專利審查基準 修正草案
<p>6.1 Probable cause or motivation The following cases can be strong grounds for determining that a person skilled in the art would have been led to the claimed invention based on the cited invention; suggestions shown in the disclosures of the cited inventions, close similarity of a problem to be solved, close similarity of a function, work, or operation, close relevance of technical fields.</p>	<p>3.4.1進步性之判斷步驟 (3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：</p>	<p>3.4.1.1考慮引證間結合動機的情況 審查進步性時，通常會涉及複數先前技術之結合，應考量是否有動機而明顯結合主要引證之技術內容與其他引證之技術內容，而非考量相關先前技術與申請專利之發明間的關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，判斷是否有動機而明顯結合主要引證之技術內容與其他引證之技術內容得綜合考量3.4.1.1.1「技術領域之關連性」、3.4.1.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.1.3「功能或作用上之共通性」或3.4.1.1.4「教示或建議」等事項。一般而言，存在越多前述事項，其結合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈明顯，但也可能因為存在一個有力的事項，而認定其結合係屬明顯。</p>

2、教示或建議

KIPO專利審查基準(2013.7)	TIPO專利審查基準 2014年版	TIPO專利審查基準修正草案
<p>6.1.1 Suggestions shown in the disclosures of the cited inventions Suggestions shown in the disclosures of the cited inventions relevant to a claimed invention can be strong grounds for determining that a person skilled in the art would have been led to the claimed invention.</p>	<p>(d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議 若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯</p>	<p>3.4.1.1.4教示或建議 若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於主要引證之技術內容與其他引證之技術內容結合的教示或建議，該教示或建議會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將主要引證之技術內容與其他引證之技術內容結合。 若相關先前技術中存在複數引證之間結合的教示或建議，原則上，所屬領域中具有通常知識者會有強烈動機結合該等先前技術。</p>

3、所欲解決問題之共通性

KIPO專利審查基準(2013.7)	TIPO專利審查基準 2014年版
<p>6.1.2 Close similarity of a problem to be solved (1) A close similarity of a problem to be solved can be a strong ground for determining that a person skilled in the art would have been led to the claimed invention by applying or combining cited inventions. If the technical problems to be solved described in the claimed invention and cited invention are not in the same technical field, the examiner decides whether the technical problem of the claimed invention is obvious in the relevant field of the art or easily deducible in light of technical common sense and whether that reasoning can be used as a ground for denying the inventive step by scrutinizing the technical problem. (2) Even in the case of a cited invention with a different problem compared to a claimed invention, if it is obvious that a person skilled in the art can easily arrive at a the claimed invention through a mere exercise of ordinary creativity, the inventive step of the claimed invention can be denied.</p>	<p>(b)相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性 若發明所屬技術領域中具有通常知識者針對發明所欲解決之問題，會促使其結合相關先前技術，通常其結合係屬明顯。</p>
	<p>TIPO專利審查基準 修正草案 3.4.1.1.2所欲解決問題之共通性 所欲解決問題之共通性，係指複數先前技術間是否包含實質相同之所欲解決問題。 判斷某一先前技術之所欲解決問題，可由先前技術中已記載的所欲解決問題，或可客觀認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者能顯而易知的問題或可容易想到的問題等進行考量。 若主要引證之技術內容與其他引證之技術內容在所欲解決問題上具有共通性，則該所欲解決問題之共通性會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將主要引證之技術內容與其他引證之技術內容結合。</p>

4、功能或作用上之共同性

KIPO專利審查基準(2013.7)	TIPO專利審查基準 2014年版	TIPO專利審查基準 修正草案
<p>6.1.3 Close similarity of a function, work, or operation If a close similarity in a function, work, or operation exists between a claimed invention and a cited invention or between cited inventions, there can be a well-founded ground that a person skilled in the art would have arrived at the claimed invention.</p>	<p>(c)相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性 若相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上相同或相關，通常其結合係屬明顯。</p>	<p>3.4.1.1.3功能或作用上之共通性 功能或作用上之共通性，係指複數先前技術間是否包含實質相同之功能或作用。 若主要引證之技術內容與其他引證之技術內容二者於功能或作用上具有共通性，則該功能或作用上之共通性會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將主要引證之技術內容與其他引證之技術內容結合。</p>

5、技術領域之關連性

KIPO專利審查基準(2013.7)	TIPO專利審查基準 修正草案
<p>6.1.4 Close relation of technical fields A publically known technical means for solving the technical problem of the claimed invention in a related technical field can be a strong ground for considering that a person skilled in the art could have achieved the claimed invention.</p>	<p>3.4.1.1.1技術領域之關連性 技術領域之關連性，係指複數先前技術之技術領域是否為相同或相關。 判斷某一先前技術之技術領域，可藉由應用該技術之物、原理、機制(mechanism)、作用等進行考量。 判斷複數先前技術間之技術領域是否具有關連性，亦即是否屬相同或相關技術領域，原則上係考量該等先前技術所應用之物、所欲解決之問題、功能或作用等是否為相同或合理相關者。若複數先前技術所應用之物相同，則屬相同技術領域，若其所應用之物不同，但所欲解決之問題、功能或作用等為合理相關，則屬相關技術領域。 若主要引證與其他引證屬相同或相關之技術領域，其結合未必即屬明顯，必須進一步考量3.4.1.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.1.3「功能或作用上之共通性」或3.4.1.1.4「教示或建議」等一個以上事項之結合可能性，以綜合判斷其結合是否明顯。</p>
<p>TIPO專利審查基準 2014年版 (a)相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性 若相關先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，可解決發明所欲解決之問題，通常其結合係屬明顯。</p>	

6、反向教示

KIPO專利審查基準(2013.7)	TIPO專利審查基準 修正草案
<p>8. Other factors to be taken into account in determining obviousness (1) If a prior art document teaches not referring to the prior art thereof, i.e., if there is a description in the prior art document that precludes the reasoning that a person skilled in the art would easily arrive at the claimed invention, the inventive step is not denied by the prior art despite the similarity between the prior art and the claimed invention. In addition, the fact that the prior art in a prior art document is described as inferior cannot be necessarily considered as a factor that precludes the inventive step.</p>	<p>3.4.1.3.2 反向教示 反向教示係指某一相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，包含相關先前技術已明確排除申請專利之發明中已知技術特徵之結合，或基於相關先前技術所揭露之技術內容，所屬技術領域中具有通常知識者，將被勸阻不會依循該等技術所採的途徑。判斷相關先前技術是否具有反向教示，必須就其實質內容來判斷。例如，先前技術揭露較佳實施方式或特定實施例，或先前技術揭露超過一種以上的擇一形式記載(alternative)，而申請專利之發明為非較佳實施例或較廣泛的揭露、或為擇一形式記載之其中一種，因先前技術之內容並未明確排除申請專利之發明或對申請專利之發明有任何勸阻，所以不會構成反向教示。例如，申請專利之發明為一種以環氧樹脂為主的印刷電路材料...該先前技術亦揭示以環氧樹脂為主的材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其效果較以聚醯胺樹脂為主的材料為差，雖然該先前技術已教示該以環氧樹脂為主的材料可用於申請人所預期達成的目的，但並未明確排除申請專利之發明或對申請專利之發明提出任何勸阻，因此，不能據此認定該先前技術對於該以環氧樹脂的印刷電路的材料有反向教示。</p>
<p>TIPO專利審查基準 2014年版 (d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議 ...惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯。</p>	

伍、交流議題

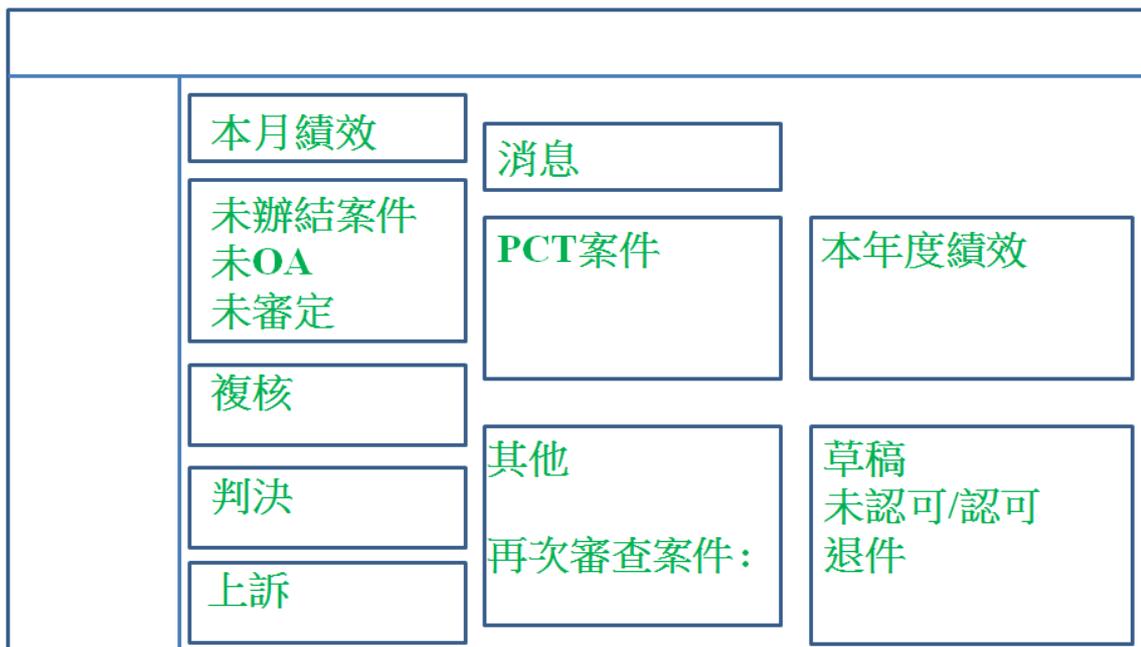
一、韓國智慧財產局審查系統簡介

新人進入韓國智慧財產局後，先對印章及簽名建立電子檔，如下圖所示。



由於韓國智慧財產局的線上審查系統可使韓國審查官不在辦公室內亦可審案，惟當審查官未在韓國智慧財產局內網而欲使用線上審查系統前，需先登入韓國政府系統，登入後不可連外網。當已在韓國智慧財產局內網或已登入韓國政府系統，需使用手機app取得限時30秒之登入通行碼後登入KIPO Cloud，其介面類似遠端桌面連線，可保留工作畫面，並有專用通訊messenger。

在KIPO Cloud裡可開啟線上審查系統，其首頁包含本月績效、本年度績效、未辦結案件、再次審查案件、草稿等製稿系統，並可查詢所審查的案件之後續狀況。開啟後之介面如下圖所示。韓方表示，基於個資之考量，我方並不能對螢幕拍照，且韓國智慧財產局系統亦是韓文介面，故相關系統圖示皆由韓方審查官口述介紹，再由我方繪製如下圖。



點選未OA(Office Action，審查意見通知函)案件列表，將出現審查官所負責且尚未發出審查意見通知函的案件清單；其中，於申請號前面所出現的紫色圖樣，係指該案件之申請日較晚，尚不能進行審查，如下圖所示。

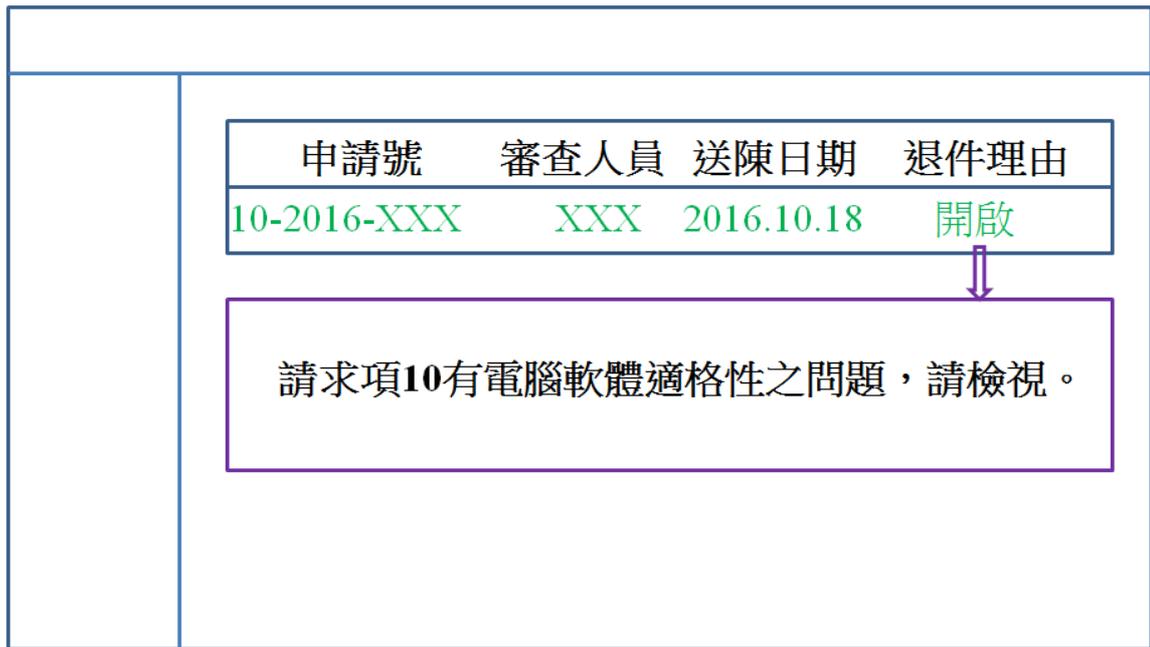


點選未發出審查意見通知函的案件清單中的案件後，將出現案件基本資料，如下圖所示。其中，Similar Patent Search System係指韓國智慧財產局系統將以IPC與關鍵字自動檢索前案；OPD(One Portal Dossier)係指專利五大局(IP5)所建立連結各國專利家族審查履歷的介面，提供專利家族的審查歷程及點擊連結各國審查意見及檢索報告，其介面與日本特許廳的介面相似。

	<table border="1"> <tr> <td>申請號</td> <td>OPD</td> <td>檢索</td> </tr> <tr> <td>10-2016-XXXXX1</td> <td colspan="2">Similar Patent Search System</td> </tr> </table>	申請號	OPD	檢索	10-2016-XXXXX1	Similar Patent Search System	
	申請號	OPD	檢索				
	10-2016-XXXXX1	Similar Patent Search System					
	PCT WIPO EP US JP CN						
案件基本資料							
來文資料	<table border="1"> <tr> <td>審查意見編製</td> <td>核准</td> <td>核駁</td> </tr> </table>	審查意見編製	核准	核駁			
審查意見編製	核准	核駁					

點選案件基本資料的審查意見編製，將可編輯審查意見，其中有一個頁面與我方的發明專利案審查表暨檢索報告編製系統的審查意見頁面相似，在其上點選相關之不准專利理由後，系統會在編輯審查意見之處自動代入相關文字。

若審查意見尚未編輯完畢，將會出現在線上審查系統首頁的草稿區。編輯完畢後，點選審查意見編製頁面的送陳後，將會移至線上審查系統首頁的未認可區，待科長認可後，則會再移至認可區；若科長不認可，將會移至退件區。退件區頁面裡有退件理由選項，點選後會出現科長不認可的理由，如下圖所示。韓方審查官表示，科長亦可能以電話或當面告知退件理由。



韓國智慧財產局內有專門人員處理逾限修正之不受理，故不會有認定受理逾限修正是否延宕審查程序之情事。另關於韓國智慧財產局各審查科內部案件認可機制簡介如下：每個審查科除科長外，另有4位小組長，其工作係協助科長進行核稿之認可，科長亦可兼任小組長。審查官所完成之審查意見通知函及核准審定送陳後，僅需經過小組長的認可即可發文；若是核駁審定，則需得到小組長及科長的認可。小組長所完成之審查意見通知函及核准審定送陳後即可自行判發；若是核駁審定，則需得到科長的認可。此外，於再次審查之案件，若小組長發出核准審定，亦需得到科長的認可。相關認可機制簡介表列如下。

認可		小組長	科長
審查官	OA	V	
	核准	V	
	核駁	V	V
小組長	OA	V	
	核准	V	
	核駁	V	V
	再次審查核准	V	V

因韓文與日文文法相近，於韓國智慧財產局內部檢索系統可將日文文獻自動翻譯成韓文後進行全文檢索。且由於進行檢索時系統已知所檢索之申請案，故在檢索報告編製作業頁面可直接點選帶入檢索式之選項後自動將檢索式帶入，如下圖所示。

檢索報告編製作業

X	Y	引用文獻	相關請求項

帶入檢索式

韓國審查官核准案件時，由於韓國智慧財產局系統自動抽換公告本，相較於由審查官手動抽換更能減少公告本抽換錯誤的機率。另外，目前韓國智慧財產局尚未提供申請人查詢預計何時發出首次審查意見通知函機制。

韓國智慧財產局系統中具有智慧審查系統(Smart Examination System)，以進行除錯，其功能如下：

(1)申請案自動分析(Automatic Analysis of Applications)：檢查申請案的形式錯誤，例如：在一個請求項中有兩個以上發明。

(2)通知錯誤檢測(Error Detection in Notifications)：檢測所有審查官手動發出通知的錯誤，例如：用錯法條、請求項漏審等。

二、臺韓新型專利制度比較

韓國新型專利制度與我國略有不同，簡介如下：兩國申請標的皆為物品，說明書皆需有圖式，專利期間皆為10年。韓國智慧財產局對新型專利進行實質審查，其審查密度較發明專利為低；本局則進行形式審查，並搭配技術報告。此外，在韓國智慧財產局可對新型專利提起加速審查(Accelerated Examination Program，AEP)，於本局則否。相關比較表列如下。

	KIPO	TIPO
標的	物品	物品
實質審查	Yes	No (技術報告)
審查密度	較低	形式審查
圖式	Yes	Yes
AEP	Yes	No
專利期間	10年	10年

三、韓美專利合作檢索計畫(KR-US CSP)

韓美專利合作檢索計畫(Collaborative Search Program, CSP)係美國專利商標局(USPTO)與韓國智慧財產局(KIPO)合作之CSP，於2015年9月1日開始施行，其概念係當相同發明之專利申請案在兩個專利局申請，與一般請求專利審查相比，專利局分享實體審查之先前技術清單並促進審查過程。

使用KR-US CSP之申請人有下列益處：

1. 速度：藉由促進或加速審查繞過積案以更快取得專利。
2. 穩定性：經由首次通知前的檢索結果交換增強篩選過程，以取得更強且無懈可擊的專利。
3. 費用：申請人請求CSP時，沒有徵收行政費用，有時申請人可以免除收取請求促進審查的費用，故可節省經費。

韓國智慧財產局專利制度管理科副科長韓周哲先生表示，關於前述的第1點及第3點，由於申請人可以免費並更快取得專利，故申請人滿意度很高；另關於第2點，由於案件的檢索過程強化造成核駁率較一般案件略高，但申請人可以取得更為穩定的專利，故申請人對此還算滿意。總體來說，韓國申請人大致上滿意KR-US CSP之制度。

參加KR-CSP的案件，須符合以下10點條件：

a) 在KIPO與USPTO提出的申請案需有相同的最早日期。

*最早日期：優先權日與申請日中較早者。

b) 最早日期在2013年3月16日或之後。

c) 申請實審在申請CSP之前或同時。

d) 在首次通知之前申請CSP。

e) 請求項總數 ≤ 20 項，且其中獨立項 ≤ 3 項。

f) KIPO與USPTO的對應請求項相同(發明的範疇不能改變)。

g) 基於一件申請案而申請CSP。

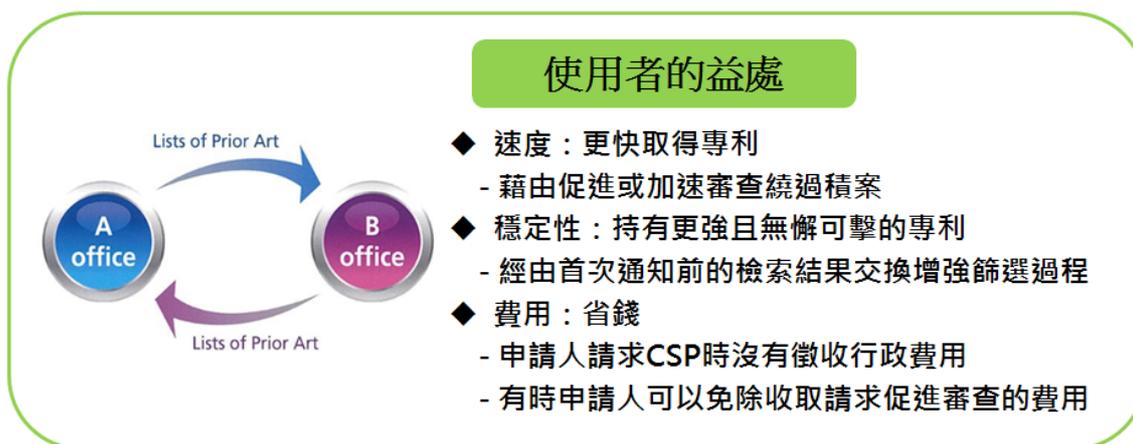
h) 於KIPO與USPTO的申請人相同。

i) 符合發明單一性的需求。

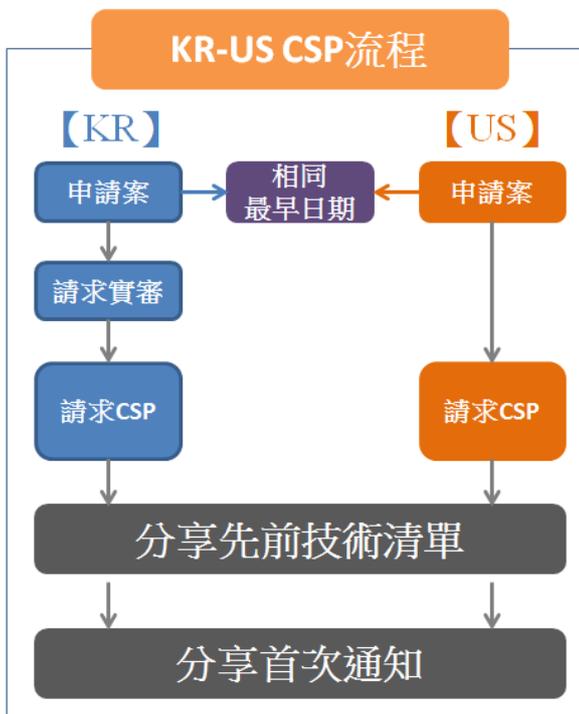
j) 不能有多項附屬項。

關於KR-US CSP之流程及相關介紹如下圖所示。

概念	當相同發明之專利申請案在兩個專利局申請，與一般請求專利審查相比，專利局分享實體審查之先前技術清單並促進審查過程。
目前狀況	KR-US CSP (2015.9.1~)



- 參加KR-US CSP的條件**
- a) 在KIPO與USPTO提出的申請案需有相同的最早日期
*最早日期：優先權日與申請日中較早者
 - b) 最早日期在2013.3.16或之後
 - c) 申請實審在申請CSP之前或同時
 - d) 在首次通知之前申請CSP
 - e) 請求項總數 ≤ 20項，且其中獨立項 ≤ 3項
 - f) KIPO與USPTO的對應請求項相同(發明的範疇不能改變)
 - g) 基於一件申請案而申請CSP
 - h) 於KIPO與USPTO的申請人相同
 - i) 符合發明單一性的需求
 - j) 不能有多項附屬項



四、韓國專利師考科

在韓國欲報考專利師考試，需具備大學以上之學歷且不限科系方可報考。考試分為兩試，第一試的考科包含4大科目，第1科為工業財產法(包含：專利法、新型專利法、商標法、外觀設計法)，第2科為民法(親屬、繼承除外)，第3科為自然科學概論(包含：物理、化學、生物、地球科學)，第4科為英文(已被英文檢定取代)。

通過第一試後可報考第二試，第二試的考科分為必修科目及選擇科目。必修科目包含專利法、商標法、民事訴訟法。選擇科目則由下列考科擇一選考：外觀設計法、著作權法、工業設計、機械設計、熱力學、金屬材料、有機化學、化學反應工程、電磁學、迴路理論、半導體工程、控制工程、醱酵工程、分子生物學、藥品製造化學、纖維材料學、鋼筋混凝土學、資料結構、生物藥劑學。相關考科資訊表列如下。

		考科			
第一試		工業財產法(包含：專利法、新型專利法、商標法、外觀設計法)			
		民法(親屬、繼承除外)			
		自然科學概論(包含：物理、化學、生物、地球科學)			
		英文(已被英文檢定取代)			
第二試	必修科目	專利法			
		商標法			
		民事訴訟法			
	選擇科目 (擇一)	外觀設計法	著作權法	工業設計	機械設計
		熱力學	金屬材料	有機化學	化學反應工程
		電磁學	迴路理論	半導體工程	控制工程
醱酵工程		分子生物學	藥品製造化學	纖維材料學	
鋼筋混凝土學		資料結構	生物藥劑學		

第一試考科英文已被英文檢定所取代，相關檢定及成績要求表列如下：

	TOEIC	TEPS	TOEFL			G-TELP	FLEX
			CBT	IBT	PBT		
一般人	775	700	220	88	560	77	700
聾者	387	420	146	41	373	51	350

另外，在韓國智慧財產局勤務者若滿足下列條件，報名韓國專利師考試可減免考科：

(1)在韓國政府官員系統中高於5職等(不限審查官)

(2)在韓國智慧財產局中以前述身分工作5年以上

符合上述條件的韓國智慧財產局勤務者參加韓國專利師考試，可享有第一試免除，及第二試的必修科目及選擇科目皆只需選考一科之考科減免。

韓國審查官表示，在2016年的韓國專利師考試中，第一試共有3737人報考，606人通過；第二試共有1251人報考，211人通過。

五、專利資訊策進中心(Patent Information Promotion Center, PIPC)簡介

專利資訊策進中心主要業務為協助韓國智慧財產局進行專利申請案先前技術檢索、進行專利申請案 IPC 及 CPC 分類、企業檢索、專利分析、及智財諮詢，其功能類似本國的檢索中心(PSC)。人數約六百人，平均年齡約 40 歲。

專利檢索使用檢索系統與韓國智慧財產局相同之外，另外自行開發了另外的檢索系統，可檢索機器翻譯的中國專利文獻。可檢索韓國國內未公開之專利文獻。

除了企業檢索外，亦進行專利地圖分析、路線圖趨勢、專利評分、智財諮詢等促進智慧財產發展業務。

六、韓國專利法院

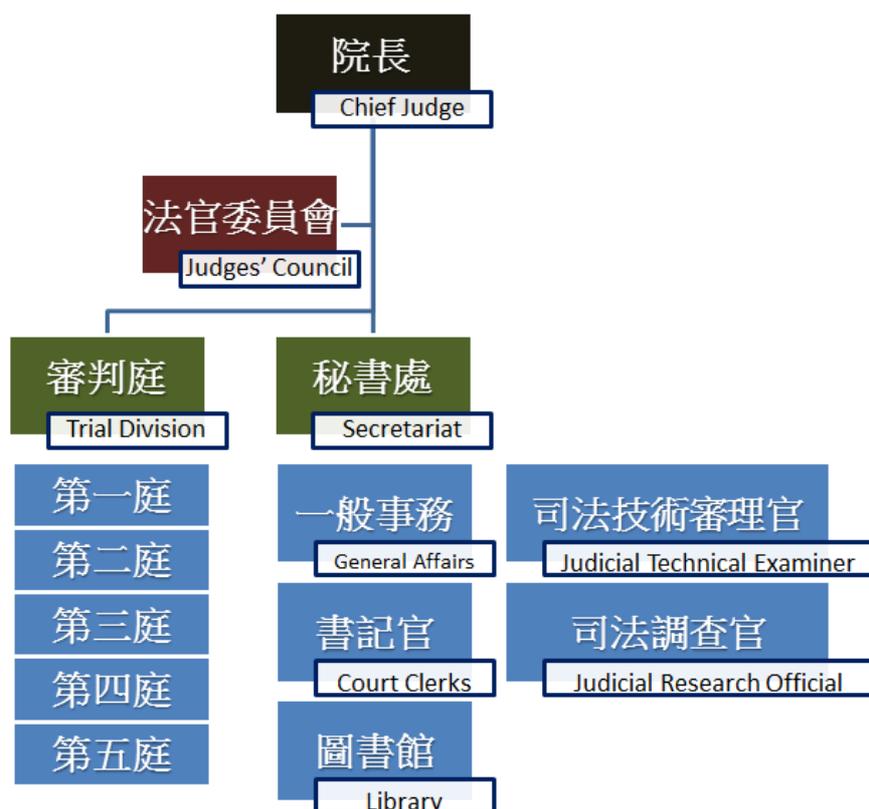
(一)韓國專利訴訟制度簡史

在韓國，最早的專利訴訟制度係KIPO－最高法院之制度。然而在1995年9月28日韓國憲法法院決議中，上述之訴訟制度被認為是"違反法官審判之權"，故韓國開始籌備組成專利法院，並於1998年3月1日建立韓國專利法院(Patent Court of Korea)，形成KIPO－專利法院－最高法院之制度。時至2016年1月1日，韓國更集中行政與民事案件之審判權於專利法院。相關圖示如下。



(二)專利法院組織

韓國專利法院設有院長(Chief Judge)1人，並有法官委員會(Judges' Council)，下設5個審判庭(Trial Division)，每個審判庭各有3名法官；並設有秘書處(Secretariat)，管理一般事務(General Affairs)、書記官(Court Clerks)及圖書館(Library)。另設有司法技術審理官(Judicial Technical Examiner)共17人，其中有15人自韓國智慧財產局借調，2人由專利法院自行聘用；還設有司法調查官(Judicial Research Official)共4人，皆由專利法院自行聘用。相關專利法院組織示意圖如下所示。

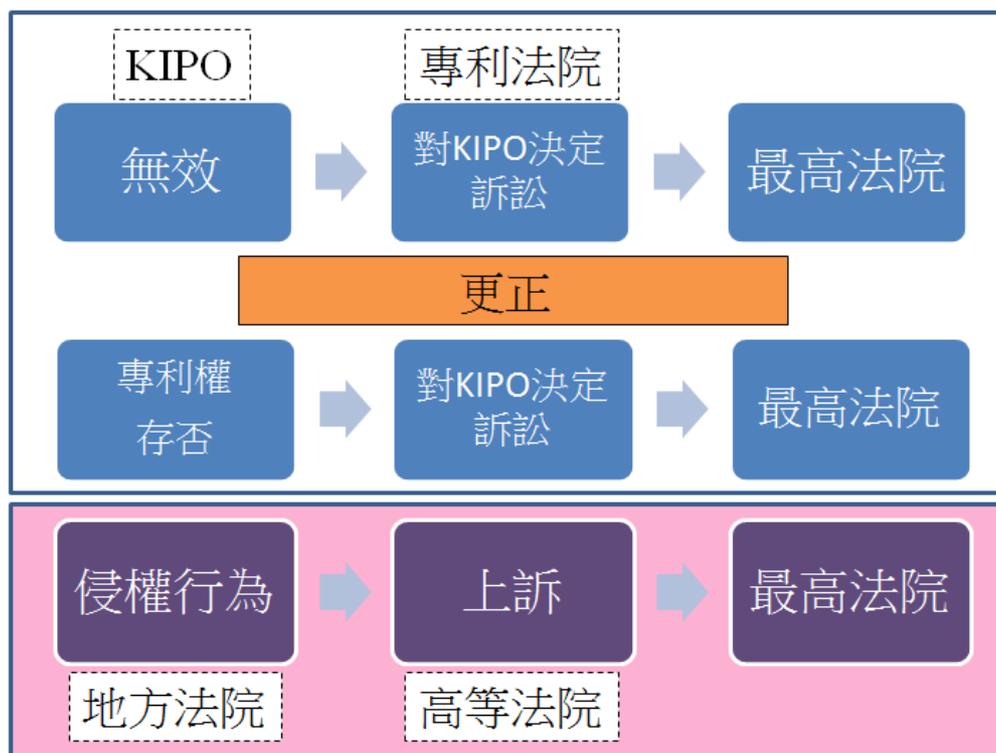


專利法院內各技術領域之司法及技術專業輔助人人數表列如下，其中括號內數字為司法調查官名額。

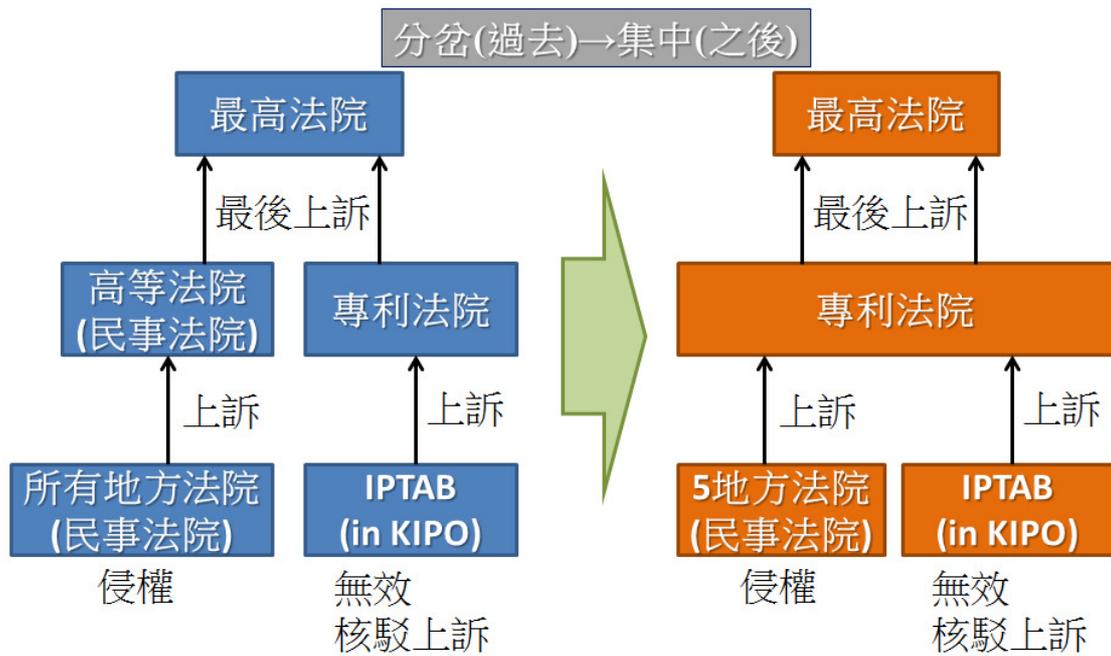
部門	名額
機械(Machinery)	6(1)
化學(Chemistry)	4(1)
電子(Electronics)	4(1)
電信(Telecommunications)	2
藥劑學(Pharmacy)	3(1)
土木工程(Civil Engineering)	1
農藝(Agriculture)	1
總計	21

(三)韓國智慧財產案件訴訟制度及其演進

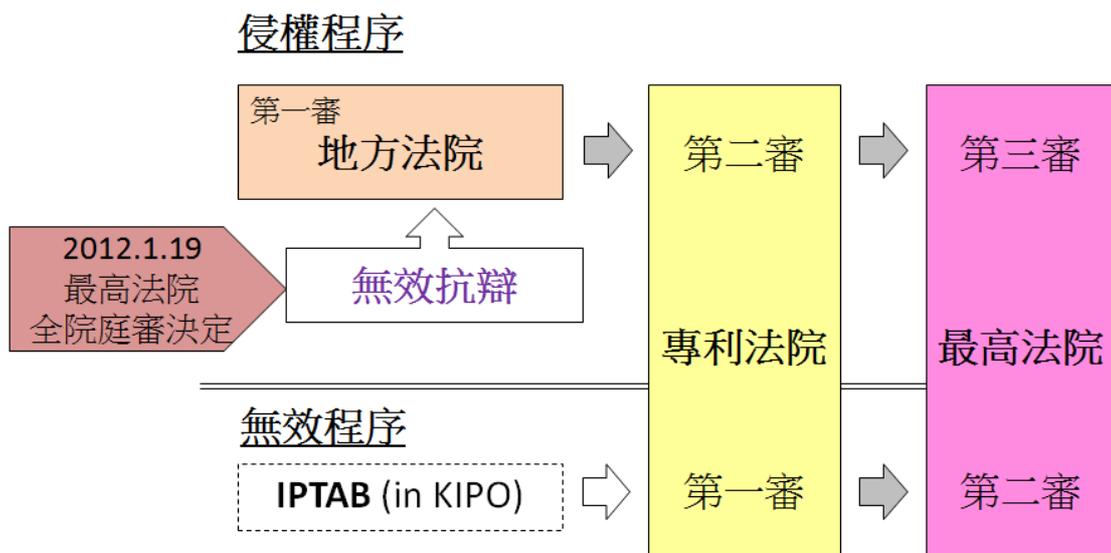
對於發明專利、新型專利、商標、設計專利相關案件之訴訟，在過去之時，若欲提起無效或專利權存否(核駁上訴)之請求，則先需在韓國智慧財產局內的智慧財產審判及上訴委員會(Intellectual Property Tribunal, IP Trial and Appeal Board, IPTAB)提起，若不服決定則可上訴至專利法院對KIPO決定提起訴訟，若再不服專利法院之判決則可最後上訴至最高法院，過程中皆可提出更正請求。若欲提起侵權行為之請求，則可至所有地方法院的民事法院提起，不服判決則可上訴至高等法院的民事法院，再不服高等法院之判決則可最後上訴至最高法院。故過往之韓國智慧財產案件訴訟制度係分岔的(Bifurcated)。相關圖示如下所示。



現行之韓國智慧財產案件訴訟制度則由分岔改為集中(Concentrated)。若欲提起無效或核駁上訴之請求，仍需在韓國智慧財產局內的IPTAB提起；若欲提起侵權行為之請求，目前韓國僅有5間地方法院的民事法院接受請求。上述之請求若不服結果者，皆上訴至專利法院，再不服者則可最後上訴至最高法院。相關圖示如下所示。

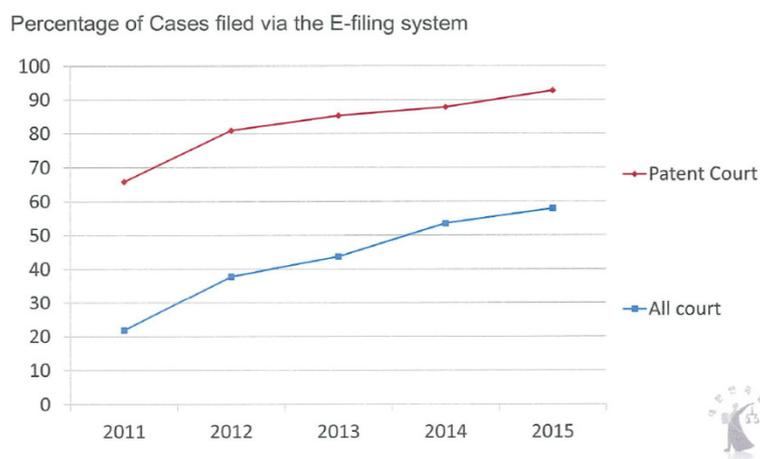


在韓國，對於專利無效還提供了專利無效雙軌制。在侵權程序中，自2012年1月19日最高法院全院庭審決定後，第一審在地方法院的訴訟攻防中，可提起無效抗辯；第二審則上訴至專利法院，第三審則上訴至最高法院。另在無效程序中，先在韓國智慧財產局內的IPTAB提起無效程序，第一審則上訴至專利法院，第二審則上訴至最高法院。相關圖示如下所示。

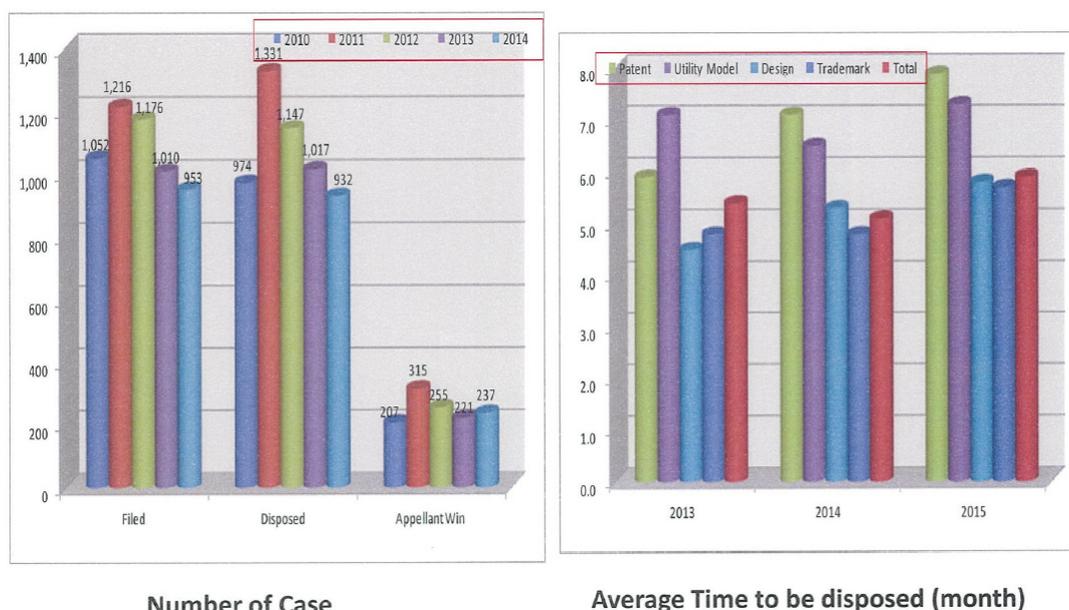


(四)統計數據

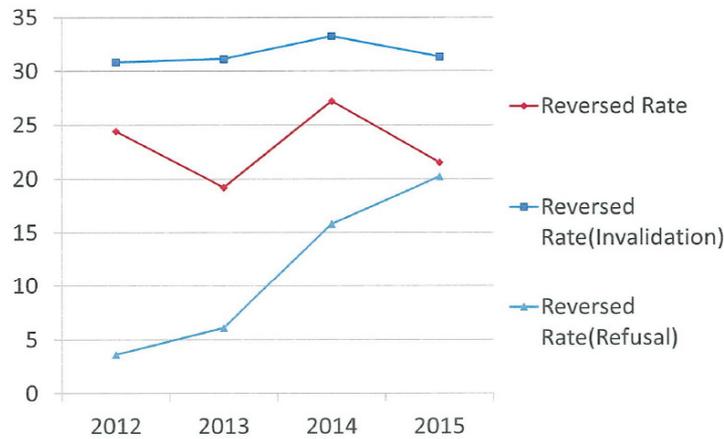
關於韓國專利法院的電子申請案件統計，如下圖所示，其中專利法院的電子申請比例達90%以上，高於其他法院。



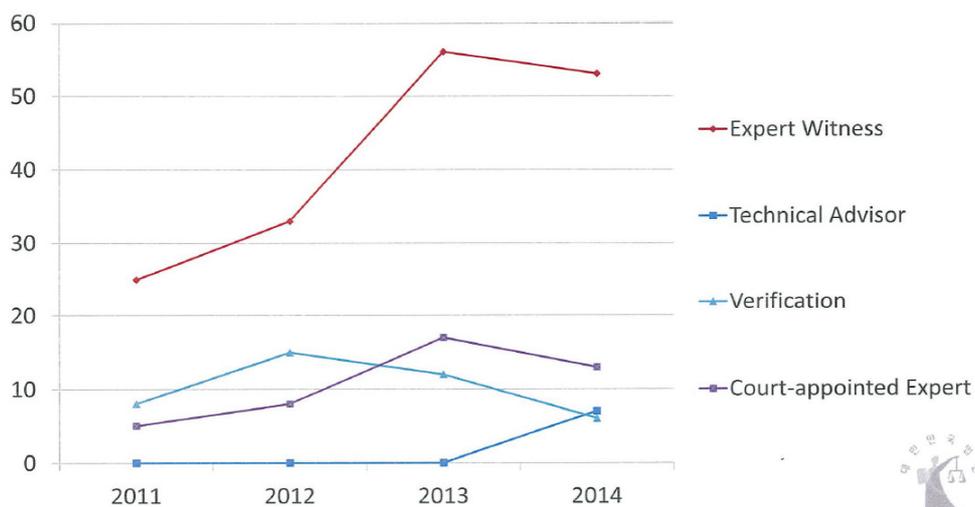
關於韓國專利法院的案件數及平均處理時間(月)，如下圖所示。其中關於案件數，在2014年共有953件案件申請，處理932件，上訴人勝訴共237件；關於平均處理時間，在2015年發明專利的處理時間約為7.9個月，平均處理時間約為5.9個月。



關於撤銷率統計，如下圖所示。其中在2012至2015年間，無效案撤銷率約為31~34%之間，核駁案撤銷率由2012年的約4%逐年上升至2015年的約20%，平均撤銷率約為19%~27%之間。

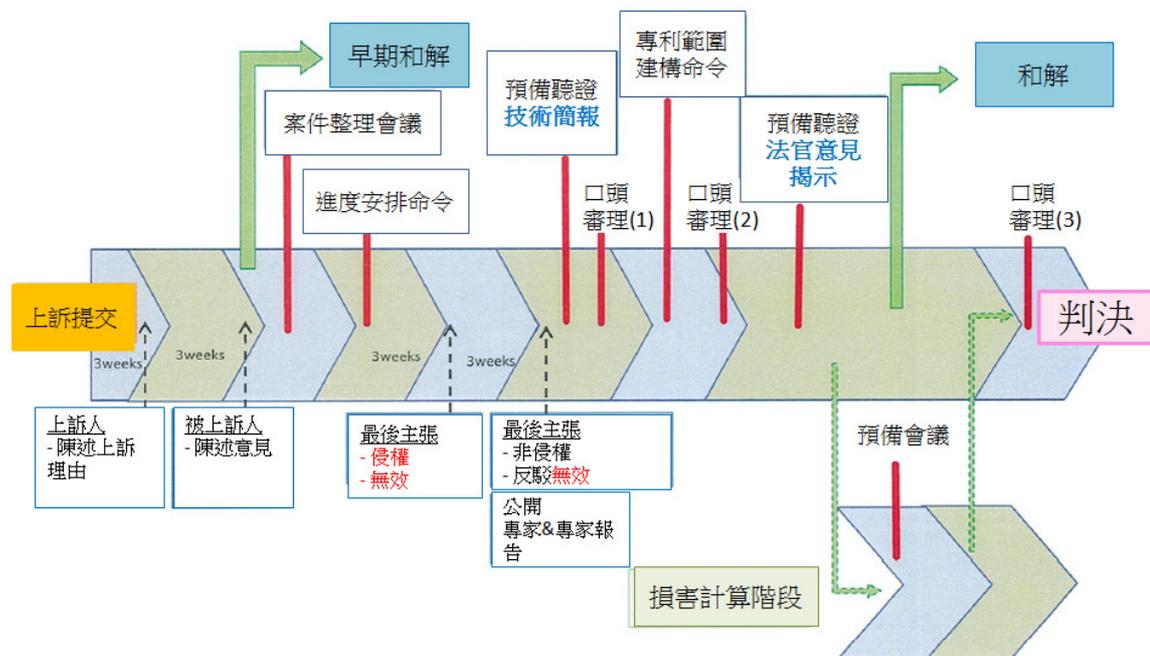


關於證據件數統計，如下圖所示。其中在2011至2014年間，專家證人(Expert Witness)之件數皆高於技術顧問(Technical Advisor)、鑑定(Verification)及法院指定專家(Court-appointed Expert)。負責簡介的Jongchan KIM先生表示，所統計的資料來源係指以進步性作為理由之案件。



(五)新的專利侵權案件進行原則

關於專利侵權訴訟的模範時間線(Model timeline)簡介如下：上訴提交(Appeal Filed)後，上訴人(Appellant)在3週內陳述上訴理由(statement of grounds of appeal)，被上訴人(Appellee)在之後的3週內陳述意見(statement of response)。接下來進入早期和解階段(Settlement in early stage)，並舉行案件整理會議(Case Management Conference)；之後發出進度安排命令(Scheduling Order)，在3週內要提出侵權或無效之最後主張(Final Contention)，在之後的3週內提出非侵權或反駁無效之最後主張，並公開專家及專家報告(Disclosure of Experts & Experts reports)。接著進行預備聽證(Preparatory Hearing)以提供技術簡報(Technical Presentation)，並舉行第一次口頭審理(Oral Hearing)；之後有專利範圍建構命令(Claim Construction Order)，並舉行第二次口頭審理。接著舉行預備聽證以揭示法官意見(Judges opinion revealed)；若需計算損害，則進入損害計算階段(Damage Calculation Stage)，並舉行預備會議(Preparatory Conference)。接著試行和解(Settlement)。在之後的第三次口頭審理中，會將損害計算階段的結果一併審理，最後下達判決(Judgment)。相關圖示如下所示。



陸、心得及建議

一、心得

在去(104)年第一屆臺韓專利審查官交流活動所建立的良好基礎上，本局與韓國智慧財產局於本年度續辦第二屆臺韓專利審查官交流活動。本次臺韓專利審查官交流活動係第一次由本局派遣審查官前往位於大田廣域市的韓國智慧財產局進行交流，能身為其中一員，榮幸之至。雖曾參加去年臺韓專利審查官交流，並已有數次與日本專利審查官交流之經驗，但由於係第一次前往大田廣域市，行前不免有緊張之感；所幸有局內長官的指導以及同仁的支援，讓我們出發前的準備工作能夠順利進行，也更瞭解如何應對韓國審查官。感謝交流期間韓國智慧財產局所安排的辦公室環境介紹及專利審查近況簡介，讓我們能了解韓國智慧財產局的工作環境、最近的發展與修法動向；專利資訊策進中心與專利法院的參訪，更能讓我們了解在檢索階段韓國檢索人員如何與審查人員互動、檢索人員的檢索工具、韓國專利法院的組織架構與近期發展等等。到各審查科交流時，線上審查系統的功能、KR-US CSP的介紹及臺韓雙方新型專利的比較，更是讓人印象深刻。而在案件交流過程中，非常感謝韓國審查官的審查經驗分享，除讓我們更加了解韓國之專利法及專利審查基準外，對於審查意見的撰寫、請求項明確性的判斷方式以及進步性引證間結合動機之比較，均可做為我們日後審查時之參考。

在韓國智慧財產局交流的這一週，韓方及專利資訊策進中心、專利法院的接待人員皆相當親切及友善；感謝韓國審查官從早到晚熱心的陪伴，以及交流部門長官熱情的招待，讓我們體驗韓國文化之時亦有賓至如歸之感。另外，在韓國智慧財產局還遇到許多韓國審查官有學習中文，並熱情的以中文與我們討論臺灣文化，讓身在他鄉的我們備感窩心。在交流活動結束之後，即便仍有問題請教，韓國智慧財產局的人員們依然熱心地幫忙解決疑惑，對此我們銘感於心。此外，感謝多年來本局與韓國智慧財產局良好互動所奠定之友善關係，才能讓我們在此次交流中備感韓方的熱情與友善，也才能讓此次交流順利進行。本次交流對口李靜恩審查官在韓國智慧財產局係採用在家審案的工作方式，即每週僅至韓國智慧財

產局辦公一日；但為了本次交流活動，李靜恩審查官亦於韓國智慧財產局所在地大田廣域市當地旅館下榻數日，讓人感受到其對這次交流活動的付出與熱忱。

韓文在本國普及程度不如英文及日文，韓國的智慧財產資訊相對於中國、美、日、歐五大局的資訊較不易取得與解讀，因此本次臺韓雙邊的交流在對國際了解實為重要，特別是對於專利申請量為全球第四的韓國智慧財產局。本次交流也取得了第一手最新與重要的資訊，期望未來臺韓雙邊良好互動實際合作持續進行。

二、建議

交流人員建議安裝在韓國最普及的通訊App，因韓國智慧財產局人員回覆該通訊App的速度比回覆email的速度較為即時，故透過該通訊App可使溝通更為有效率，並建議保持連線狀態，以便隨時與韓方交流人員聯繫。另由於大田廣域市區內很多韓文並未附有英文翻譯，故若參與交流的我方人員對韓文不了解，建議安裝附有照片文字翻譯功能之翻譯App，並善用其照片文字翻譯的功能。

為拉近距離，可以學習韓語的問候用語；於交流時韓國智慧財產局人員很常問到，韓流(K-Pop)在臺灣是否很流行，故亦可以在出發前夕對韓流做簡單了解；在與韓國智慧財產局主管對談時，其有時亦會提到韓國的時事新聞，故若能對韓國時事有所認識亦會有所幫助。此外，我方人員若帶有伴手禮，如鳳梨酥或局內紀念品，在交予韓方人員時如能簡單介紹，使受禮者能了解禮物背後的意涵，將會更有意義。

韓國智慧財產局的線上審查系統，提供IPC與關鍵字自動檢索前案功能，使審查官可初步獲得相關之前案，縮短檢索之時間；並提供查詢所承審案件之後續狀況，使審查官能了解所承審案件於後續審查階段之意見；相似於本局發明專利案審查表暨檢索報告編製系統的審查意見頁面上點選相關之不准專利理由後，系統將於審查意見通知函自動帶入相關文字，有助於本局的審查意見之用語統一及英文翻譯；檢索系統可以韓文檢索日文文獻全文之功能，使審查官於檢索時不受語言之限制，有效檢索前案。眾多功能，值得本局參考。此外，本局之專利公開資訊查詢系統雖已提供外界查詢專利申請案件之公開資料及審查歷程，惟該系統上之文件資料均係中文版本；而韓國之K-PION(Korean Patent Information Online Network)系統，則提供英文化之資料。故對於不識當地文字之外國使用者而言，K-PION於使用上較為便利，對於使用者在閱讀及使用上較為友善，亦可作為本局參考。